○国立大学法人長崎大学長　片峰　　茂
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　42
①22、31　②白内障硝子体手術装置　一式　③購入等　④６月　⑤長崎大学病院管理課調達第一担当　長崎市坂本１－７－１　電話095―819―7218
Summary
Nagasaki University
①22, 31　②Cataract Vitreous Surgical System 1 Set　③Purchase　④June／2013　⑤Supplise Section, Management Division, Nagasaki University Hospital, 1―7―1 Sakamoto Nagasaki-shi Japan TEL 095―819―7218

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年５月１日
国立大学法人名古屋大学
財務担当理事　藤井　良一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23
○第２号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　ナノテクノロジー向けハイパフォーマンスＥＢリソグラフィシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　最大100kVの電圧で加速された電子ビームを試料上３nm未満に集光できること。この時，電子ビームの電流値は100pA以上で，電流値揺らぎは0.1%以下であること。
Ｂ　電子ビーム偏向により２㎜×２㎜の大面積描画を行うことができること。また，フィールド端まで中心部分と変わらない精度で描画が行えること。
Ｃ　試料ステージはレーザ測長器により１nm以下の精密な位置決めが可能であり、高さセンサによる試料高さ自動補正機能を持つこと。
Ｄ　ビーム偏向フィールドと試料ステージ移動により150㎜×150㎜以上の描画領域を持ち、フィールドつなぎ精度が±９nm以内であること。
Ｅ　ビームの偏向歪み、偏向湾曲，偏向非点補正機能を有し、また、ビーム偏向と試料ステージとの間の振幅、回転の補正機能を有すること。
Ｆ　10個以上の試料ホルダーを予備室から自動搬送できること。
Ｇ　ＣＡＤデータ生成・変換プログラムを備え、コンピュータ制御によりパターン自動描画ができること。
Ｈ　アラインメントマーク検出による位置決め・歪み補正機能を有し、複数の描画を±９nm以内の精度で重ね合わせることができること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年６月３日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒464―8601 名古屋市千種区不老町　名古屋大学本部２号館２階財務部契約課　小川　晃史　電話052―789―5527
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月１日から平成25年６月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年５月９日14時00分
⑵　開催場所　名古屋大学IB電子情報館北棟５階電気系会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High performance EB lithography system for nanotechnology 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Electron beam with a maximum acceleration voltage of 100 kV must be focused with a beam diameter of less than 3 nm on the sample surface, where the electron beam current must be 100 pA or more and its stability must be within 0.1%.
B　Maximum scanning area of the electron beam must be 2㎜-square or more, and the accuracy of the beam positioning must be constant within the beam scanning window.
C　The accuracy of the sample stage positioning must be 1 nm or better by built-in laser interferometers, and the EB system must have automatic focusing mechanism to avoid beam defocusing during the pattern drawing.
D　The system must have a maximum drawing area of 150㎜ square or larger, and the accuracy of the drawing connection at the boundary of the beam scanning window must be ±9 nm or better.
E　The system must have functions to correct the beam distortion, bending, and astigmatism, and also have functions to adjust the difference between electron beam positioning and mechanical stage positioning.
F　The system must have a sample banking chamber which can contain 10 sample holders or more and have a function of automatic holder loading to the exposure chamber.
G　The system must have a PC or workstation to create and convert commonly used CAD data for the exposure, and also the PC or workstation controls the EB system for the automatic pattern drawing.
H　The system must have a function to detect alignment marks on the sample to adjust the position and distortion of the sample, which makes it possible to superimpose the multiple layer patterns with an accuracy of ±9 nm or better.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 3, June, 2013
⑹　Contact point for the notice : Ogawa Koji, Contract Division, Financial Affairs Department, Nagoya University, Furo-cho Chikusa-ku Nagoya-shi 464―8601 Japan, TEL 052―789―5527

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年５月１日
国立大学法人名古屋大学
財務担当理事　藤井　良一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23
○第３号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　高分解能透過型電子顕微鏡を基本設備とし、透過像観察及び走査透過像観察により、試料の原子構造、電子状態、組成を観察・分析ができること。
Ｂ　照射系に収差補正装置が組み込まれていること。
Ｃ　電子銃は冷陰極型電界放出電子銃であること。
Ｄ　走査像観察時における点分解能が0.1nm未満であること。
Ｅ　電子エネルギー損失分光器を投影レンズ以降に搭載していること。
Ｆ　設置予定場所の温度、湿度等に関する環境整備を含むこと。